

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. Juli 2005 (07.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/061132 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B08B 7/00**,
C23C 16/44, B01D 24/00, H01L 21/3213

[DE/DE]; Warmuthsreut 29, 95511 Mistelbach (DE).
KALLEE, Klaus [DE/DE]; Bahnhofstrasse 7, 06188
Landsberg (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/000250

(22) Internationales Anmeldedatum:
15. Januar 2004 (15.01.2004)

(74) Anwalt: **SCHRÖER, Gernot, H.**; Meissner, Bolte & Partner,
Bankgasse 3, 90402 Nürnberg (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 58 275.4 11. Dezember 2003 (11.12.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **WIESSNER GMBH** [DE/DE];
Dr.-Hans-Frisch-Strasse 4, 95448 Bayreuth (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

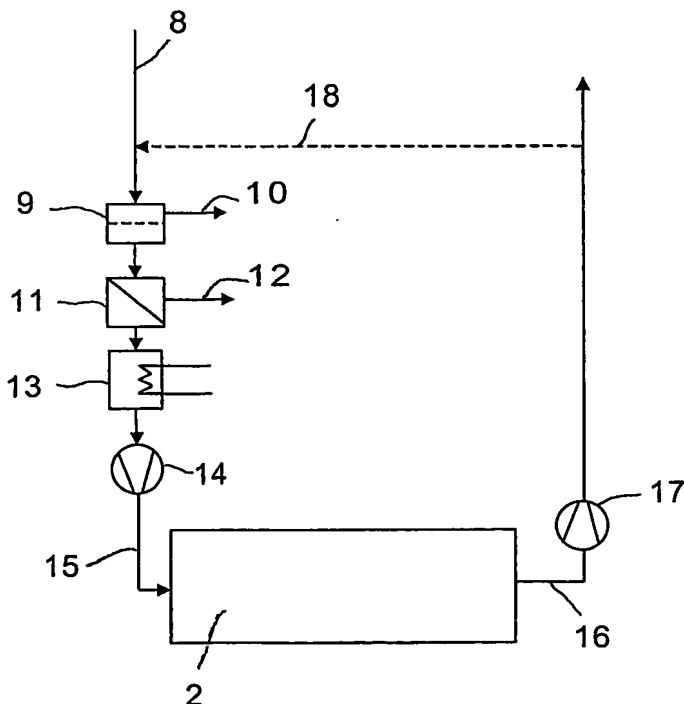
(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HEPPER, Ronald**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CLEANING AT LEAST ONE PROCESS CHAMBER USED FOR COATING AT LEAST ONE SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM REINIGEN WENIGSTENS EINER PROZESSKAMMER ZUM BESCHICHTEN WENIGSTENS EINES SUBSTRATS



(57) Abstract: The invention relates to a method and device for cleaning at least one process chamber (7) that is used for coating at least one substrate (3), especially a glass substrate. According to the invention, the at least one process chamber (7) is flushed with a conditioned bleed gas (15) prior to a coating process.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Reinigen wenigstens einer Prozesskammer (7) zum Beschichten wenigstens eines Substrats (3), insbesondere aus Glas, wobei die wenigstens eine Prozesskammer (7) vor einem Beschichtungsvorgang mit einem konditionierten Spülgas (15) gespült wird.

WO 2005/061132 A1



(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.